

# KRI 考夫曼离子源自动控制器 Power Supply and Control

产品名称	KRI 考夫曼离子源自动控制器 Power Supply and Control
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:Power Supply 产地:美国
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

## 产品详情

KRI [Ion Source](#) Power Supply and Power Pack Controllers 功率控制器KRI [Ion Source](#)

应用领域：无栅极等**离子源**技术----End-Hall

离子/等离子源有栅极**离子源**技术----RFICP **离子源**----DC **离子源电子源**技术----灯丝----中空阴极

(Hollow cathode)----等离子中和器单机应用----直流电源 (DC power)----射频电源 (RF

power)有多个模组组成，模组的特性取决于功率、频率、电压、电流和控制方式，大多数模组都满足 CE 和 CoHS 标准。监控：监视器稳定输出：设置优化状态诊断：用户直接获取参数存储：准确保存连续性和稳定性功率控制器能够在紧急情况下比如载入高能量的等离子体、短路、电流过冲、电压过冲和功率过冲的情况，实现保护功能。确保在运行沉积和刻蚀工艺时进行不间断的操作。通过数显的面板，可以即时观测和控制工艺参数和状态资讯。KRI Individual Power Supply Controller 独立的功率控制器功率控制器可以单独使用也可以集成到其它功率包中，能提供直流、交流和射频功率。AC Power 交流电源交流电源输出一个低频的直流信号，适用于低阻抗负载，比如驱动类似于灯丝这样的发热原件，通过大的功率加热灯丝到发射热电子的温度。交流电源比直流电源更有利于灯丝寿命的延长软起功能有助于平稳的tiga o灯丝温度从冷起到电子发射的温度型号：FC 1000FC 1006DC Power 直流电源直流电源通常应有在等离子体辉光放电、偏压和离子加速。可提供几千瓦的输出功率，电压范围 80~1000 V。典型应用是用于离子、等离子和电子源的电极和衬底偏压。对阳极施以电压点燃和维持等离子放电对等离子施以偏压去定量离子能量对离子光栅施以偏压去扑捉和加速离子对阴极施以电压获得电子流输出的电压、电流和调节模式可选，可更具需要选择输出值像等离子电位、离子能量、电子流和离子轨道等参数。RF Power 射频电源射频电源产生一个射频信号，适用于低阻抗的电磁负载，典型应用是驱动射频天线将能量辐射进等离子腔室。通过感应耦合的方式射频功率产生和维持一个高密度的等离子。通过自动阻抗匹配使功率大的传输优化，此外设计上使电容耦合和功率衰减更小化。型号：RF 1000RF 1500气体控制器：KRI 气体控制器提供功率和控制多路品质liuliang计，能够使用于不同的气体和气体混合物，而且可以和几乎所有的不同制造商的模组相容，数字显示模式。使用者可以自行设置liuliang并有存储功能。型号：GC 1000自动系统控制器：是一个可程式设计的单元，能集成到电源模组中去提供适合的功率控制。该控制器采用的通信协定与功率模组进行快捷的通信，实现控制功能。它能够自动选择更优的模式去校准等离子负载，达到更稳定的状态，同时可以选择回馈模式。能存储多个工艺程序，同时控制多个 MFC。自动系统控制器：

是一个可程式设计的单元，能集成到电源模组中去提供适合的功率控制。该控制器采用的通信协定与功率模组进行快捷的通信，实现控制功能。它能够自动选择更优的模式去校准等离子负载，达到更稳定的状态，同时可以选择回馈模式。能存储多个工艺程序，同时控制多个MFC。KRI Integrated Power Pack Controller 电源模组集成包电源模组集成包有独立的电源模组衍生而来，因为 KRI 的独立电源模组是一种标准的模组，所以这些模组能够容易的集成到自动、多功能的功率包中。集成包是一个强有力的工具，能够简化等离子、离子和电子源的操作，可以方便的实现功率控制的更优化。当经常应用在如下的场合：1. 工艺工程师想实现宽范围的工艺设计和优化，渴望确保参数的重复性，工艺可控2. 生产经理理想实现一个简单的命令操作，使工艺参数快速稳定3. OEM 想实现高的集成度从而降低成本4. 从事薄膜表面和纳米结构的科研工作者想实现灵活、准确的工艺控制

eH Plasma Power Pack Controller---eH 等离子功率集成包eH 等离子功率集成包用于驱动 end-Hall 离子源，它由电子发射模组、等离子放电模组和自动系统控制模组组成，结构紧凑、重量轻便。适用于材料工艺中要求高效、稳定和准确的电子或离子源的功率控制。它能给 end-Hall 等离子源的阳极或阴极提供功率，使用者可根据需要设置阳极的离子密度和离子能量，同样的使用者也可以界定阴极的电子流参数。eH Plasma Power Pack 能够跟踪离子流，自动发射电子确保电中性。eH Plasma Power Pack 有自我保护功能，同时它是一个快速反应的功率源，可以在几秒钟内点火产生等离子，并在几秒钟内使离子束达到稳定。可以存储多个工艺程序、控制多个MFC确保对多种气体和气体混合物的准确控制。使用者能容易的设置各种参数和模式、状态，面板上会显示出设定值、运行值、功能表存储资讯和工作状态资讯。KRI RFICP Ion Power Pack Controller 射频感应耦合等离子功率集成包RFICP Ion Power Pack Controller 用于驱动有栅极离子源，由中和器模组、放电模组、偏压模组和加速模组组成，这些模组集成在一个 19” 的集成包中。RFICP Ion Power Pack Controller 给离子源的射频线圈、离子光学和中和器提供电源，将射频功率耦合到辉光放电腔室，产生高密度的等离子体。配有自动阻抗适配器实现更优化，用户可以选择离子能量和离子密度来满足工艺的要求。广泛用于沉积和刻蚀工艺中。射频的额定功率 0.5 KW 或更高，中和器的额定功率 0.5 A 或更高。

若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗女士